(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204826374 U
(45)授权公告日 2015.12.02

(21)申请号 201520582347.1

(22)申请日 2015.08.05

(73)专利权人 符东华
地址 570000 海南省海口市琼山区上丹村15-5号

(72)发明人 符东华

(74)专利代理机构 海口翔翔专利事务有限公司 46001
代理人 容振全

(51)Int.Cl.
E04C 1/00(2006.01)

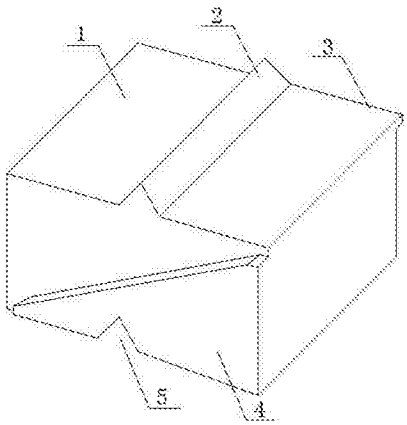
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种防水墙砖

(57)摘要

本实用新型公开了一种防水墙砖，包括砖体，在砖体顶部设置突起镶接块，在砖体底部与突起镶接块对应的位置上设置与突起镶接块形状对应的镶接槽，在砖体前侧设有排水斜面，在砖体后侧设有与排水斜面大小相对应、位置相反的连接面。本实用新型结构简单、制作成本低，采用斜面砌合的技术与排水斜面的配合，使水分无法从砖头之间的缝隙渗入墙体，并且可通过排水斜面对其进行排出，有效解决了水分无法排除在墙体内堆积的问题，提高了建筑物墙体防水效果，避免了墙体因受墙内积水侵蚀而脱落的问题，具有牢固、防水等特点。



CN 204826374 U

1. 一种防水墙砖，包括砖体，其特征在于：在砖体顶部设置突起镶接块，在砖体底部与突起镶接块对应的位置上设置与突起镶接块形状对应的镶接槽，在砖体前侧设有排水斜面，在砖体后侧设有与排水斜面大小相对应、位置相反的连接面。

2. 根据权利要求 1 所述的一种防水墙砖，其特征在于：所述突起镶接块的形状设计为圆形、三角形、多边形。

一种防水墙砖

技术领域

[0001] 本实用新型属于建筑材料技术领域，涉及一种砖头，具体是一种防水墙砖。

背景技术

[0002] 砖头是一种砌墙用的长方体石料，用泥巴烧制而成，是在人们建造各种房屋建筑时不可缺少的一种砌体材料。在建造时，人们往往会根据根据建筑工程中使用部位的不同，把砖分为砌墙砖、楼板砖、拱壳砖、地面砖、下水道砖和烟囱砖等，而砌墙砖根据不同的建筑性能分为承重砖、非承重砖、工程砖、保温砖、吸声砖、饰面砖、花板砖等。

[0003] 目前，在建造时，人们使用的墙砖大多为长方体红砖，然而在实际建筑过程中，很多建筑物在建造完成后表面会受到雨水的侵蚀，如果不及时把水分及时排出，使其在建筑物表层堆积，会造成建筑物内部渗水，甚至时墙体因长时间受雨水侵蚀造成墙体脱落等严重后果。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足而提供一种防水墙砖，采用斜面砌合的技术与排水斜面的配合，使水分无法从砖头之间的缝隙渗入墙体，并且可通过排水斜面对其进行排出，有效解决了水分无法排除在墙体内堆积的问题，提高了建筑物墙体防水效果，避免了墙体因受墙内积水侵蚀而脱落的问题。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案：

[0006] 一种防水墙砖，包括砖体，在砖体顶部设置突起镶接块，可以使砖体与上方砖体镶接，并且可以防止雨水从缝隙进入墙体，在砖体底部与突起镶接块对应的位置上设置与突起镶接块形状对应的镶接槽，可以使砖体与下方砖体进行镶接，使砖体之间镶接更为稳固，在砖体前侧设有排水斜面，排水斜面可将渗入砖体之间的水分对外排出，在砖体后侧设有与排水斜面大小相对应、位置相反的连接面，连接面可使砖体与后方砖块上的排水斜面连接。

[0007] 所述突起镶接块的形状设计为圆形、三角形、多边形。

[0008] 本实用新型结构简单、制作成本低，采用斜面砌合的技术与排水斜面的配合，使水分无法从砖头之间的缝隙渗入墙体，并且可通过排水斜面对其进行排出，有效解决了水分无法排除在墙体内堆积的问题，提高了建筑物墙体防水效果，避免了墙体因受墙内积水侵蚀而脱落的问题，具有牢固、防水等特点。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型后视图。

[0011] 图中：1、砖体，2、突起镶接块，3、连接面，4、排水斜面，5、镶接槽。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和通过实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为本实用新型的限定。

[0013] 一种防水墙砖，如图 1 所示，包括砖体 1，在砖体 1 顶部设置突起镶接块 2，突起镶接块 2 的形状可设计为圆形、三角形、多边形，在砖体 1 底部与突起镶接块 2 对应的位置上设置与突起镶接块 2 形状对应的镶接槽 5，在砖体 1 前侧设有排水斜面 4，在砖体后侧设有与排水斜面 4 大小相对应、位置相反的连接面 3。

[0014] 砌砖时，将砖与砖之间的突起镶接块和镶接槽对应镶接，将连接面和排水斜面对应连接，即可完成砌砖。

[0015] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

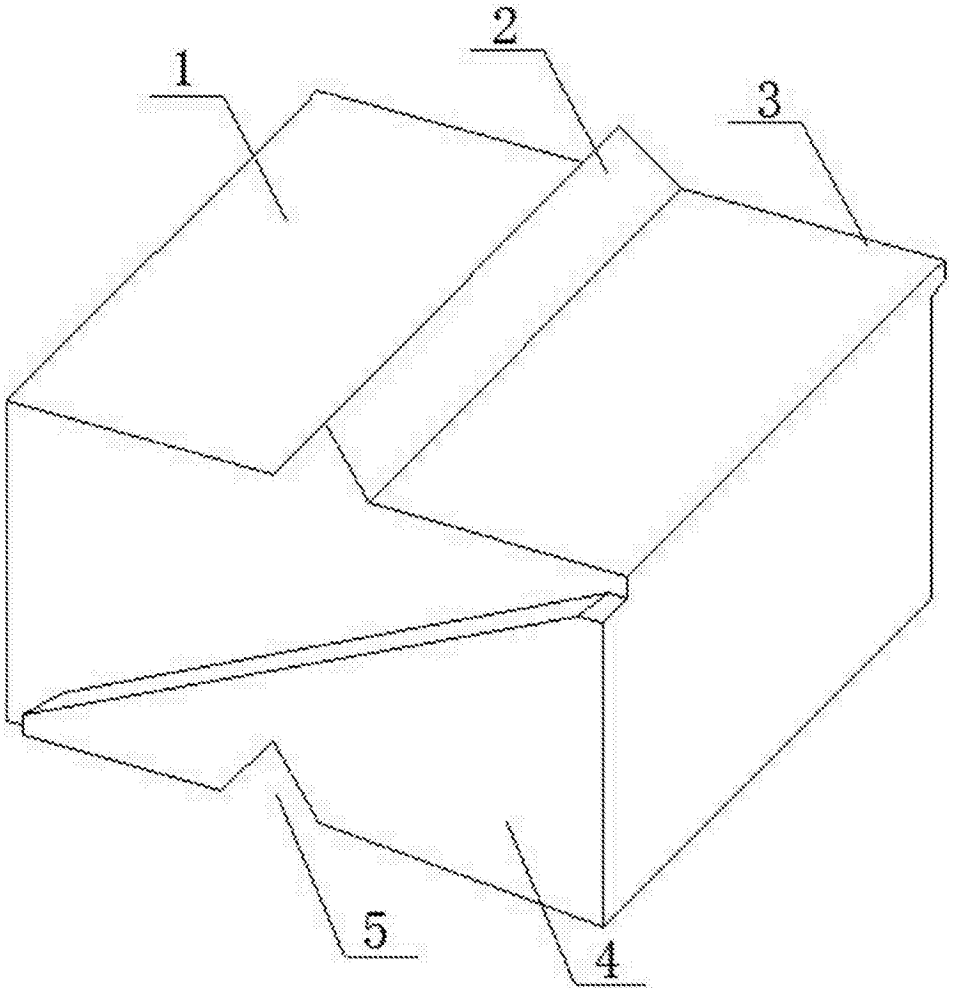


图 1

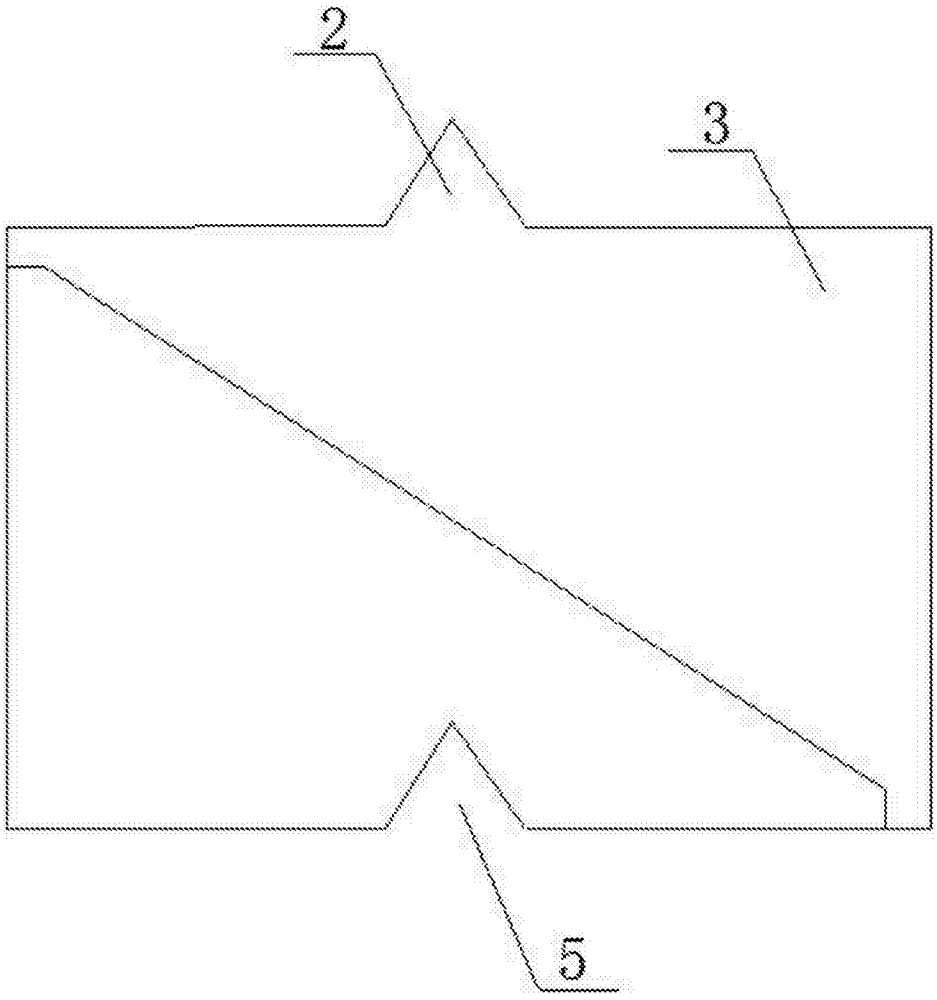


图 2